РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## <sup>(19)</sup> RU<sup>(11)</sup> 2 339 598<sup>(13)</sup> C2

(51) MПK *C04B 35/64* (2006.01) *C04B 35/45* (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

### (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2006142972/03, 04.12.2006 (72) Автор(ы): Петров Михаил Иванович (RU), (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Балаев Дмитрий Александрович (RU), 04.12.2006 Белозерова Ирина Леонидовна (RU), Гохфельд Денис Михайлович (RU), (43) Дата публикации заявки: 20.06.2008 Попков Сергей Иванович (RU), Σ Мартьянов Олег Николаевич (RU), (45) Опубликовано: 27.11.2008 Бюл. № 33 Шайхутдинов Кирилл Александрович (RU) C (56) Список документов, цитированных в отчете о (73) Патентообладатель(и): поиске: WELLHOFER F. et al. Superconductor Институт физики им. Л.В. Киренского Science & Technology. 1990. Vol.3. P.611-615. N Сибирского отделения РАН (RU) RU 2258685 C2, 20.08.2005. US 5081074 A, 14.01.1992. EP 0404966 B1, 30.11.1994. JP ω 1286954 A, 17.11.1989. ω Адрес для переписки: ဖ 660036, г.Красноярск, Академгородок, Институт G физики СО РАН, патентный отдел (0  $\boldsymbol{\infty}$ 

# (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛОТНОЙ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА

(57) Реферат:

2339

~

C Способ получения плотной текстурированной высокотемпературной сверхпроводящей керамики Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, основе висмута на использована  $\infty$ которая может быть в и транспорте. Техническим электротехнике ത результатом изобретения является получение плотного материала с высокой степенью текстуры S

простым и нетрудоемким способом. Пористую керамику плотностью от 1.8 г/см<sup>3</sup> до 2.4 г/см<sup>3</sup> пропитывают этиловым спиртом и подвергают одноосному сжатию давлением 400-500 МПа при комнатной температуре. Затем просушивают и отжигают при температуре 820-850°С в течение 30-100 часов. 5 ил.

C

N

#### RUSSIAN FEDERATION



# <sup>(19)</sup> **RU**<sup>(11)</sup> **2 339 598**<sup>(13)</sup> **C2**

N

(51) Int. Cl. *C04B 35/64* (2006.01) *C04B 35/45* (2006.01)

FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY, PATENTS AND TRADEMARKS

## (12) ABSTRACT OF INVENTION

| <ul> <li>(21), (22) Application: 2006142972/03, 04.12.2006</li> <li>(24) Effective date for property rights: 04.12.2006</li> <li>(43) Application published: 20.06.2008</li> <li>(45) Date of publication: 27.11.2008 Bull. 33</li> <li>Mail address:<br/>660036, g.Krasnojarsk, Akademgorodok,<br/>Institut fiziki SO RAN, patentnyj otdel</li> </ul> | <ul> <li>(72) Inventor(s):<br/>Petrov Mikhail Ivanovich (RU),<br/>Balaev Dmitrij Aleksandrovich (RU),<br/>Belozerova Irina Leonidovna (RU),<br/>Gokhfel'd Denis Mikhajlovich (RU),<br/>Popkov Sergej Ivanovich (RU),<br/>Mart'janov Oleg Nikolaevich (RU),<br/>Shajkhutdinov Kirill Aleksandrovich (RU)</li> <li>(73) Proprietor(s):<br/>Institut fiziki im. L.V. Kirenskogo<br/>Sibirskogo otdelenija RAN (RU)</li> </ul> |               |  |
|--|--|---------------|--|
| (54) METHOD OF PRODUCING HARD GRAIN-ORI<br>SUPERCONDUCTIVE CERAMICS ON BISMUTH B   | ENTED HIGH-TEMPERATURE   | ະ<br>ເບ<br>ເບ |  |
| (57) Abstract:<br>FIELD: construction industry.<br>SUBSTANCE: method of obtaining hard grain-<br>oriented high-temperature superconductive<br>ceramics on bismuth basis 1.9Ca2Cu3O <sub>x</sub> , which can<br>be used in electric engineering and transport<br>industry. Porous ceramics with density of 1.8 g/cm <sup>3</sup>                        | exposed to uniaxial compression with pressure of 400-500 MPa at indoor temperature. After that porous ceramics is dried and burnt off at the temperature of 820-850°C for 30-100 hours.<br>EFFECT: producing hard material with high degree of grain orientation by means of simple and non labour-intensive method.   | 598           |  |
| to 2.4 g/cm <sup><math>3</math></sup> is treated with ethyl alcohol and  | 3 ex, 5 dwg  | ဂ             |  |

```
39598
```

0 C

Изобретение относится к области технологии изготовления изделий из сверхпроводящей керамики и может быть использовано в электроэнергетике, транспорте.

Известен способ получения текстурированной высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики на основе (Bi,Pb)<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> [N.Chen, A.C.Biondo, S.E.Dorris,

- 5 K.C.Gorella, M.T.Lanagan, C.A.Youngdahl, R.B.Poeppel, Sinter-forged (Bi,Pb)<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> superconductors, Superconductor Science & Technology. 1993. Vol.6. P.674-677], использующий сложный технологический процесс, который условно можно разбить на два этапа. На первом этапе приготавливается порошок исходного химического состава (Bi<sub>1.8</sub>Pb<sub>0.4</sub>)<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2.2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, затем он прессуется (подвергается одноосному сжатию при
- 10 давлении 70 МПа) в виде брусков. На втором этапе бруски помещаются в серебряную фольгу и дополнительно подвергаются одноосному сжатию и отжигу при высокой температуре 830-860°С с заданной скоростью сжатия (0.001-0.005 мм/мин) в течение длительного времени (сотни часов). Описанный процесс имеет устоявшееся название - так называемый метод «синтеза в кузнице» ("sinter-forged method").
- 15 Недостатком данного метода приготовления текстурированных материалов является трудоемкость технологического процесса.

Наиболее близким техническим решением является метод для получения текстурированных ВТСП керамик на основе  $Bi_{1.2}Pb_{0.8}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$  и  $Bi_{1.6}Pb_{0.4}Sr_2Ca_2Cu_3O_x$  [F.Wellhofer, C.E.Gough, D.A.O'Connor, T.W.Button, N.McN. Alford, Superconductor Science &

- 20 Technology. 1990. Vol.3. P.611-615]. На первом этапе приготавливается поликристаллический материал - основа будущей текстурированной керамики в виде ленты. На втором этапе полученные ленты прессуют заново, затем отжигают при T=850°C в течение 50 часов и повторяют указанный цикл прессование - отжиг несколько раз. Недостатком данного метода приготовления текстурированных материалов является
- <sup>25</sup> длительность процесса ввиду необходимости проведения неоднократного повторения указанного цикла прессование - отжиг и низкая степень текстуры после проведения первых циклов.

Техническим результатом изобретения является получение плотного материала на основе висмутового ВТСП с высокой степенью текстуры нетрудоемким способом.

<sup>30</sup> Технический результат достигается тем, что в способе получения плотной текстурированной высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе висмута, включающем приготовление керамики, ее прессование и отжиг, новым является то, что используют пористую керамику плотностью от 1.8 г/см<sup>3</sup> до 2.4 г/см<sup>3</sup> состава

Рb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, содержащую микропоры, разделяющие пластинчатые кристаллиты <sup>35</sup> толщиной ~1 мкм, которую пропитывают этиловым спиртом, подвергают одноосному сжатию при давлении 400-500 МПа при комнатной температуре, затем высушивают и отжигают при T=820-850°C в течение 30-100 часов.

Заявляемый способ отличается от прототипа перечисленными выше признаками, которые не были проявлены в других известных технических решениях, что и обеспечивает

40 заявляемому техническому результату соответствие критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

45

На фиг.1 представлены микрофотографии текстурированного образца Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, полученные сканирующей электронной микроскопией. Снимки сделаны с участка на сломе в направлении оси прессования текстурированного образца (а) и с поверхности плоскости таблетки (б, в).

На фиг.2 представлены дебаеграмма текстурированного Bi<sub>1.8</sub>Pb<sub>0.3</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>. На фиг.3 приведена температурная зависимость удельного электросопротивления ρ(T) текстурированного BTCП Bi<sub>1.8</sub>Pb<sub>0.3</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>x</sub>.

<sup>50</sup> На фиг.4 приведены результаты измерений петель гистерезиса намагниченности М(Н) образцов текстурированного ВТСП.

На фиг.5 приведены результаты измерений петель гистерезиса намагниченности М(H) образца текстурированного ВТСП (направление магнитного поля Н параллельно с-оси кристаллитов) и для сравнения М(H) образца висмутового ВТСП поликристалла.

Пример №1

В данном способе в качестве основы будущего текстурированного материала служит не плотный поликристалл, как в описанных аналоге и прототипе, а пористая керамика Pb<sub>0.3</sub> Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, полученная способом, разработанным ранее [М.И.Петров,

- 5 Д.А.Бадаев, К.А.Шайхутдинов, С.И.Попков, Т.Н.Тетюева, С.Г.Овчинников. Способ получения пористой высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе висмута // Патент РФ, RU 2261233]. Пористая керамика Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> приготовлялась в два этапа: на первом этапе синтезируют промежуточный продукт номинального состава Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>y</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, где 1.0≤y≤1.5, при температуре 800-820°С в течение 12-24 часов,
- 10 а на втором этапе добавляют в полученный промежуточный продукт карбонат кальция СаСО<sub>3</sub> до получения стехиометрической формулы Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> с последующим совместным помолом, прессуют и окончательно отжигают его при температуре 830-850°C в течение 200-300 часов. Пористая керамика содержит микропоры, размерами 5-20 мкм, разделяющие отдельные кристаллиты, которые имеют форму пластин толщиной ~1 мкм с
- <sup>15</sup> линейными размерами от ~5 мкм до ~30 мкм. Пористые образцы плотностью от 1.8 до 2.4 г/см<sup>3</sup> были взяты в виде таблеток диаметром 20-30 мм и толщиной 7-12 мм. Жидкость (в данном случае этиловый спирт) легко проникает в поры, т.к. при такой плотности практически все поры открытые. Таблетка подвергалась прессованию в направлении оси симметрии таблетки при давлении до 500 МПа при комнатной температуре. Присутствие
- <sup>20</sup> пор дает возможность разворота пластинчатых кристаллитов так, чтобы их плоскости становились параллельными плоскости таблетки, при этом уменьшается вероятность слома кристаллитов. Присутствие жидкости с учетом ее практической несжимаемости создает для кристаллитов условия, аналогичные гидростатическому давлению, что способствует равномерному компактированию кристаллитов по всей глубине таблетки. Для
- <sup>25</sup> выпаривания остатков спирта прессованные таблетки помещают в сушильный шкаф при T= 70°C на 5 часов. После прессования таблетки значительно уменьшаются в размере относительно исходного: толщина - 2-3 мм, диаметр - 20-30 мм (диаметр определяется размером пресс-формы). Затем образцы проходили отжиг при температуре 830°C в течение 30 часов. Отжиг при высокой температуре T=830°C обеспечивает рост
- <sup>30</sup> кристаллитов и обеспечивает их спайность и, как следствие, хороший электрический контакт между ними. Плотность полученных образцов составила р=5,29±0,01 г/см<sup>3</sup> (89% от теоретической, теоретическая плотность составляет 5.95 г/см<sup>3</sup>). В результате только одного цикла прессование-отжиг получаются таблетки ВТСП с высокой степенью текстуры и большим диамагнитным откликом.
  - На фиг.1 представлены микрофотографии текстурированного образца Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, полученные сканирующей электронной микроскопией. Снимки сделаны с участка на сломе в направлении оси прессования текстурированного образца (а) и с поверхности плоскости таблетки (б, в). Видно, что в разных направлениях
- 40 образец демонстрирует качественно различную микроструктуру. В направлении оси прессования (фиг.1а) пластинки расположены в основном перпендикулярно оси прессования, т.е. параллельно плоскости таблетки, пластинки кристаллитов имеют толщину ~1 µm, т.е. ту же толщину, что и пластинки в исходном пористом ВТСП. Кристаллографическая ось-с кристаллитов направлена перпендикулярно плоскости
- 45 пластин кристаллитов. На фиг.1а отчетливо видны границы между кристаллитами. Микрофотографии поверхности плоскости таблетки (фиг.1б, в) также подтверждают то, что пластинки кристаллитов лежат в плоскости таблетки, т.е. а-b плоскости кристаллитов ориентированы параллельно плоскости таблетки. Анализ микрофотографий, сделанных с поверхности таблетки с разным увеличением (фиг.1б, в), показывает, что нет четких
- границ, разделяющих отдельный кристаллит со всех сторон. Есть отдельные участки
   границ между кристаллитами, но они в большинстве не охватывают отдельный кристаллит.
   Это особенно видно при сравнении изображений межкристаллитных границ в направлении
   оси прессования (фиг.1а) и в плоскости таблетки (фиг.16, с). Неоднородности, видимые

на микрофотографиях поверхности таблетки, являются областями спайности кристаллитов. Таким образом, по данным электронной микроскопии полученный материал обладает текстурой, в которой пластинчатые кристаллиты ориентированы a-b плоскостями в плоскостях, параллельных поверхности таблетки.

- 5 На фиг.2 представлены дебаеграмма текстурированного Bi<sub>1.8</sub>Pb<sub>0.3</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>. Рефлексы соответствуют в основном структуре Bi2223. Из анализа данных на фиг.2 доля низкотемпературной фазы Bi2212 составляет менее 5%. Известно, что в поликристаллической керамике отношение интенсивностей рефлексов ∑(00I) к ∑(hkl) увеличивается с увеличением предпочтительной ориентации с-оси. Это соотношение
- 10 может быть использовано для определения степени текстуры. Для количественного анализа выбраны рефлексы Bi 2223 (002), (004), (008), (0010), (0014), (0016), (0020), и (115), (119), (1115), (1117) и (1119). Степень текстуры Р определена следующим образом [Xi Zhengping, Zhou Lian. The formation and enhancement of texture in a Bisystem superconductor, Superconductor Science & Technology. 1994. Vol.7. P.908-912]:

15  $P=\Sigma I(00I)/[\Sigma I(hkI)],$ 

где I(hkl) - интенсивность (hkl) рефлексов, ∑I(hkl) указывает суммирование интенсивности всех выбранных пиков и ∑I(00I) сумма интенсивностей рефлексов (00I)типов. Оказалось, что для полученной текстурированной керамики степень текстуры Р= 0.97±0.01, что свидетельствует о высокой степени текстуры в данном материале.

- <sup>20</sup> На фиг.3 приведена температурная зависимость удельного электросопротивления ρ(T) текстурированного ВТСП Ві<sub>1.8</sub>Pb<sub>0.3</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>. Транспортный ток задавался в направлении плоскостей а-b кристаллитов. Температура начала перехода в сверхпроводящее состояние составляет ~113 К. Температура, при которой сопротивление образца становится равным нулю, составляет 106 К. Зависимость ρ(T) выше Т<sub>с</sub> имеет
- 25 металлический ход. Полученные результаты свидетельствуют о том, что полученный материал обладает хорошими сверхпроводящими характеристиками, подобно плотным текстурированным образцам.
- На фиг.4 приведены результаты измерений петель гистерезиса намагниченности М(H) образцов текстурированного ВТСП. Образец для измерений был выпилен из таблетки в форме куба размерами 2×2×2 мм<sup>3</sup>. Одна из граней куба совпадала с плоскостью таблетки. Т.е. а-b плоскости пластинчатых кристаллитов расположены параллельно двум противоположным граням куба и, соответственно, перпендикулярны четырем другим граням. Измерения проводились при 2-х вариантах ориентации магнитного поля H по
- отношению к преимущественному направлению кристаллитов в образце: Н||с и Н||а-b. Из фиг.4 видно, что диамагнитный отклик в направлении Н||с больше, чем в направлении Н||а-b. Т.е. полученный текстурированный материал обладает анизотропией магнитных свойств. Из величины диамагнитного отклика и характерного размера кристаллитов в различных направлениях можно оценить величину внутригранульного критического
- 40 тока J<sub>C</sub><sup>a-b</sup> и J<sub>C</sub><sup>c</sup>. Для оценки внутригранульного критического тока была использована теория [В.В.Вальков, Б.П.Хрусталев. Намагничивание гранулированных ВТСП в сильных магнитных полях. - ЖЭТФ, 1995. Т.107 (4), С.1221-1231], которая опирается на классическую модель Бина, но в отличие от модели Бина учитывает гранулярную структуру поликристаллического образца. Согласно результатам цитированной работы, для оценки
- <sup>45</sup> плотности критического тока поликристаллических образцов можно воспользоваться простой формулой J<sub>C</sub>≈2.7×10<sup>6</sup>×∆M(0)/d, где J<sub>C</sub> плотность критического тока кристаллитов в плоскости, перпендикулярной направлению поля в А/см<sup>2</sup>; ∆M(0) ширина петли намагниченности в нулевом поле в эме/г; d средний размер кристаллитов в направлении, параллельном вектору внешнего поля, в микрометрах. По данным
- <sup>50</sup> электронной микроскопии (фиг.1а) толщина кристаллитов в направлении с-оси составляет d~1 μm, тогда внутригранульная плотность тока в ab-плоскости составляет J<sub>C</sub><sup>ab</sup>~135×10<sup>6</sup> А/см<sup>2</sup>. Для того чтобы получить значение критического тока по с-оси необходимо знать

характерный размер кристаллитов в ab-плоскости. Как отмечалось выше, в плоскости, параллельной ab-плоскостям кристаллитов, отдельные кристаллиты не разделены четкими границами со всех сторон, см. фиг.1б, в. Четкие границы ограничивают обычно кластер, включающий в себя несколько спаянных кристаллитов. Средний размер такого

- 5 кластера d~50÷100 мкм. Используя такое значение d, получим для внутригранульного критического тока вдоль с-оси J<sub>C</sub><sup>c</sup>~0.55÷1.1×10<sup>6</sup> А/см<sup>2</sup>. Параметр анизотропии, определяемый как J<sub>C</sub><sup>a-b</sup>/J<sub>C</sub><sup>c</sup>, будет достигать значения ~125÷250. Полученные величины критического тока и значение параметра анизотропии типичны для висмутовых ВТСП. Это подтверждает, что полученный материал обладает высокой степенью текстуры.
- <sup>10</sup> На фиг.5 приведена зависимость намагниченности от магнитного поля М(Н) образца из висмутового ВТСП поликристалла, в котором кристаллиты расположены хаотически, т.е. текстура отсутствует и для сравнения зависимость М(Н) текстурированного ВТСП в направлении Н⊥а-b (Н||с-оси). Видно, что диамагнитный отклик текстурированного ВТСП
- в направлении Н⊥а-b в 2.6 раза больше, чем для поликристалла. Высокие значения диамагнитного отклика и, как следствие, силы левитации важны для применений ВТСП в транспорте.

Пример №2

Текстурированный ВТСП был приготовлен аналогичным способом в один цикл

- 20 прессование-отжиг, как описано в примере №1. Пористая керамика Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> плотностью 2.4 г/см<sup>3</sup> была взята в виде таблетки диаметром 30 мм и толщиной 12 мм. Она пропитывалась этиловым спиртом, подвергалась прессованию в направлении оси симметрии таблетки при давлении 400 МПа при комнатной температуре. После выпаривания остатков спирта в сушильном шкафу при T=70°C в течение 5 часов проводился отжиг при температуре T=850°C в течение 100 часов.
  - Плотность полученных образцов составила <sub>ρ</sub>=5,28±0,01 г/см<sup>3</sup>. Результаты исследования микроструктуры, магнитных и резистивных свойств полученных образцов оказались схожими с результатами, приведенными для примера №1 на фиг.1-5 Пример №3
- 30 В данном способе текстурированный ВТСП был приготовлен аналогичным способом в один цикл прессование-отжиг, как описано в примерах №1, №2. В качестве основы будущего текстурированного материала служит пористая керамика Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> плотностью 1.8 г/см<sup>3</sup>, взятая в виде таблетки диаметром 20 мм и толщиной 8 мм. Она пропитывалась этиловым спиртом, подвергалась прессованию в направлении оси
- <sup>35</sup> симметрии таблетки при давлении 500 МПа при комнатной температуре. После выпаривания остатков спирта в сушильном шкафу при T=70°C в течение 5 часов проводился отжиг при температуре T=820°C в течение 50 часов. Плотность полученных образцов составила р=5,30±0,01 г/см<sup>3</sup>. Результаты исследования микроструктуры, магнитных и резистивных свойств оказались идентичны результатам, приведенным для
  - <sup>⊄</sup> примеров №1, №2 на фиг.1-5. Основываясь на результатах, полученных для примеров №1, №2, №3, можно сделать следующие выводы:
    - (1) варьирование давления прессования при комнатной температуре от 400 до 500 МПа,
    - (2) варьирование температуры отжига в пределах от 820°С до 850°С,
- 45 (3) увеличение времени отжига от 30 до 100 часов, практически не изменяет объемную плотность полученных текстурированных образцов, не оказывает заметного влияния на микроструктуру, а также сверхпроводящий переход и магнитные свойства текстурированных образцов.
- <sup>50</sup> Таким образом, разработан технологически простой метод получения текстурированных ВТСП на основе висмута, позволяющий получать материалы с высокой степенью текстуры и большими значениями диамагнитного отклика. Использование заявляемого изобретения позволит

- применять текстурированные ВТСП материалы в качестве активных элементов

ограничителей тока короткого замыкания на основе ВТСП, работающих при температуре жидкого азота,

- использовать текстурированные ВТСП материалы в сверхпроводящих подвесах, сверхпроводящих подшипниках и сверхпроводящих накопителях энергии.

5

15

#### Формула изобретения

Способ получения плотной текстурированной высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе висмута, включающий приготовление керамики, ее прессование и отжиг, отличающийся тем, что используют пористую керамику плотностью от 1,8 до 2,4

<sup>10</sup> Г/СМ<sup>3</sup> состава Pb<sub>0.3</sub>Bi<sub>1.8</sub>Sr<sub>1.9</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub>, содержащую микропоры, разделяющие пластинчатые кристаллиты толщиной ~1 мкм, которую пропитывают этиловым спиртом, подвергают одноосному сжатию при давлении 400-500 МПа при комнатной температуре, затем высушивают и отжигают при T=820-850°C в течение 30-100 ч.

| 20 |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 25 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |





Страница: 8

RU 2339598C2



Фиг.2



Страница: 10

